⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公

#### ⑫特 許公 報(B2)

平5-44762

@Int. Cl. \*

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 平成5年(1993)7月7日

H 01 B 3/12 C 04 B 35/00 35/49 302

J S

栄

9059-5G 8924 - 4 G 7310-4G

発明の数 1 (全7頁)

❷発明の名称 高誘電率磁器組成物

辻

②特

頤 昭61-89649

每公 朗 昭62-254305

願 昭61(1986)4月17日 20出

❷昭62(1987)11月6日

@発 明 者 ②発 明 者

洋 八 Ш 下 垣 勝 実 山形県長井市幸町1番1号 マルコン電子株式会社内 山形県長井市幸町1番1号 マルコン電子株式会社内

個発 明 者 渡

稲 部 武

山形県長井市幸町1番1号 マルコン電子株式会社内

砂出 願 人 マルコン電子株式会社

山形県長井市幸町1番1号

審査 官 徾

昭57-27974 (JP, A) 匈参考文献 特開

特公 暇41-13311 (JP, B 2) FPO3-0235 00 WO - TP 1 **'03**, (2.2

## の特許請求の範囲

1 一般式

 $xPb(Zn_{1/2}Nb_{2/2})$   $O_2$ 

SEARCH REPORT

 $-yPb(Mg_{1/2}Nb_{2/3}) O_3-zPbTiO_2$ 図の

(x=0.50, y=0.00, z=0.50)

(x=1.00, y=0.00, z=0.00)

(x=0.20, y=0.80, z=0.00)

(x=0.05, y=0.90, z=0.05)

で示される各点を結ぶ線内の組成のPbの一部を 1~35mol%のBa及びSrの少なくとも一種で置 換したことを特徴とした高誘電率磁器組成物に対 して重量比で0.01~1.0重量%の酸化銀AgO、酸 一種を含むことを特徴とした高誘電率磁器組成 物。

## 発明の詳細な説明

### 〔発明の技術分野〕

(Zn<sub>1/2</sub>Nb<sub>2/3</sub>) O<sub>3</sub>を主体とした誘電率温度係数 (T.C.C) が小さく信頼性に優れた高誘電率磁器 組成物に関する。

### 〔発明の技術的背景とその問題点〕

従来、誘電率が3000を越えるような高誘電率磁 25 温度は1300~1400℃と高温であり同時焼成される

特開 昭62-31905 (JP, A)

2

器材料としては、チタン酸パリウム(BaTiOx) 系材料が主体として用いられている。今日ではこ の材料をもちいて、誘電体厚み20~30μm、積層 数20~80側の積層セラミツクコンデンサ (MLC) で表したとき、それぞれの成分を頂点とする三元 5 が実用化されている。しかしながら、この材料を もちいて積層セラミツクコンデンサを作成した場 合には種々の問題点が現れてきている。誘電体厚 みの薄層化に伴い、誘電体厚みあたりに対する電 圧が増加し誘電体のDCパイアス依存性、すなわ 10 ち定格電圧が印加された時の実効容量の大幅な低 下がそのひとつである。例えば定格25V、1.0μF のF特性MLOにおいては誘電率を10000、誘電体 厚みを25μmとすると定格電圧の印加時には約70 %の容量の低下があら得られる容量は0.3μFにす 化パラジウムPdO及び酸化白金PtOの少なくとも 15 ぎない。更に誘電率温度係数 (T.C.C) を考慮す ると定格電圧の印加時に最低でも1.0µFの容量を 必要とする回路では3.3µF以上のMLCを使用しな くてはならないことになる。

また誘電体厚みの薄層化においてはその大きな 本発明は高誘電率磁器組成物に係り、特にPb 20 結晶粒子径が問題となる。通常の固相反応による BaTiO<sub>2</sub>の結晶粒子系は 4~10µmである。大容 量化をはかるため誘電体厚みを20µm以下にする と層間の粒子数が少なくなり耐電圧の低下の原因 となる。さらに、チタン酸バリウム系材料の焼成 内部電極材料は必然性にパラジウムPdや白金Pt などの高温で酸化されない高価な貴金属材料を用 いなければならず、コスト高の原因となる。この チタン酸パリウム系材料の問題点を解決すべく鉛 を含む複合ペロプスカイト化合物の研究が広く行 5 なわれている。例えば、鉄ニオブ酸鉛Pb(Fein Nb<sub>1/2</sub>) O<sub>3</sub>を主体としたもの(特開昭57-57204 号)、マグネシウムニオブ酸鉛Pb(MgiaNbus) O<sub>2</sub>を主体としたもの(特開昭55-5758号)マグ 主体としたもの(特開昭52-21699号)等が知ら れている。鉄ニオブ酸鉛を主体としたものは結晶 粒子径及び絶縁抵抗の焼成温度による変化が大き く、85℃以上における絶縁抵抗の低下が大きく高 鉛は主体としたものは焼成温度が比較的に高く、 ペロブスカイト単一相を得にくいという問題点が ある。またマグネシウムタングステン酸鉛を主体 としたものは絶縁抵抗が大きいと誘電率が小さく があつた。更にこれ等の材料を用いて作成した積 層セラミックコンデンサの耐湿負荷テストの結果 はチタン酸パリウムを用いたものと比較すると不 十分であつた。

## 〔発明の目的〕

本発明は以上の点を考慮してなされたもので誘 電率が大きく、かつその温度係数が小さく1100℃ 以下の低温で焼成でき、積層セラミツクコンデン サとしたときの耐湿負荷テストに優れた高誘電率 磁器組成物を提供することを目的とする。

## (発明の概要)

## 本発明は、一般式

 $xPb(Z_{n_1/2}Nb_{2/2}) O_3 - yPb(Mg_{1/3}Nb_{2/2}) O_3$ zPbTiO₃で表したとき、それぞれの成分を頂点 とする三元図の

- (x=0.50, y=0.00, z=0.50)
- (x=1.00, y=0.00, z=0.00)
- (x = 0.20, y = 0.80, z = 0.00)
- (x = 0.05, y = 0.90, z = 0.05)

で示される各点を結ぶ線内の組成のPbの一部を 40 1~35mol%のBa及びSrの少なくとも一種で置 換したことを特徴とした高誘電率磁器組成物に対 して重量比で0.01~1.0重亮量%の酸化銀Ag2O、 酸化パラジウムPdO及び酸化白銀PtOの少なくと

も一種を含むことを特徴とした高誘電率磁器組成 物である。従来から誘電体材料として各種の複合 ペロブスカイト化合物が検討されているが、亜鉛 ニオブ酸鉛は磁器としてはペロブスカイト構造を 取りにくく、誘電体材料としては適さないと考え られていた (NEC Research Development No.29 April 1973 p.15~21参照)。 本発明者等の研究によれば亜鉛ニオブ酸鉛の鉛の 一部をバリウム又はストロンチウムで適量置換す ネシウムタングステン酸鉛Pb(MginWine) Osを 10 ることにより磁器で安定なペロブスカイト構造を 形成できることが分かつた。更にこのような磁器 組成物は、非常に高い誘電率及び絶縁抵抗を示 し、かつ、その温度特性も極めて良好であること がわかつた。更に研究を進めた結果、この亜鉛ニ 温での信頼性に問題があるマグネシウムニオブ酸 15 オブ酸鉛にマグネシウムニオブ酸鉛及びチタン酸 鉛とを組合せることにより、更に高い誘電率と絶 縁抵抗を合せ持つ高誘電率磁器組成物が得られる ことを見出したのである。この材料に重量比で 0.01~1.0重量%の酸化銀Ag2O、酸化パラジウム 誘電率が大きいと絶縁抵抗が小さいという問題点 20 PdO及び酸化白金PtOの少なくとも一種を含むこ とにより積層セラミツクコンデンサの耐湿負荷テ ストの結果を大幅に向上できることを見出した。 以下に本発明の組成物の組成範囲について説明

> する。Me=Ba,Srは上記した一般式のペロブス 25 カイト構造を形成するための必要な元素であり、 lmol%以下だと、パイロクロア構造が混在し高 い誘電了率及び高い絶縁抵抗を示さない。35mol %以上では誘電率が1000程度以下と小さくなつて しまつたり、焼成温度が1100℃以上と高くなつた 30 りしてしまう。よつて、Me成分の置換量は、 (Pb<sub>1-a</sub>Me<sub>a</sub>) と表したとき0.01≤a≤0.35とする。 誘電体材料においては常温における容量を高く するため、誘電率が最大になるキュリー温度が常 温付近 (0~30℃) にくるようにする。本発明の 35 Me成分は上述したようにペロプスカイト構造を 形成するための必須成分であるが、また、本発明 磁器組成物のキュリー温度を下げるシフターの働 きがある。さらに、絶縁抵抗を著しく増加させ、 機械的強度も向上させる。

Me成分によるPbの置換量はキュリー温度等を 考慮して適当に選定することが可能であるが、亜 鉛ニオブ酸鉛及びチタン酸鉛の多い領域(x> 0.5、 z > 0) では10mol%以上が好ましく、マ グネシウムニオブ酸鉛の多い領域(y>0.6、z

<0.05) では1mol%以上で充分その置換の効果 を発揮する。

第1図に本発明磁器組成物の組成範囲を示す。 線分adの外側では焼成温度が1100℃以上と高く を得ることができない。

また線分cdの外側ではキュリー温度がもとも と常温付近にあるため、Me成分による置換でキ ユリー温度が大幅に低温側に移動して、常温にお 物である酸化銀Ag2O、酸化パラジジウムPdO及 び酸化白金PtOの少なくとも一種を0.01重量%か ら1重量%としたのは0.01重量%未満では積層セ ラミツクコンデンサとしたときの耐湿負荷テスト の結果を大幅に向上できる効果がほとんど期待で 15 きず1重量%以上では誘電率が大幅に低下するた めである。

つぎに、本発明の組成物の製造方法について説 明する。出発原料としてPb, Ba, Sr, Zn, Nb, Ti, Mg, Pd, Ptの酸化物もしくは焼成により酸 20 高周波用としても有効である。 化物になる炭酸塩、しゆう酸塩等の塩類、水酸化 物、有機化合物などを所定の割合で秤量し、充分 混合した後に仮焼する。この仮焼は700~850℃程 度で行う。余り仮焼温が低いと焼結密度が低下 し、また、あまり高いとやはり焼結密度が低下 25 と均一化されるため耐圧性にも優れている。 し、絶縁抵抗が低下する。

つぎに仮焼物を粉砕し原料粉末を製造する。平 均粒径は0.5~2μm程度が好ましく、あまり大き いと焼結密度が低下し、小さいと成型性が低下す した後、焼成することにより、高誘電率磁器を得 る。本発明の組成物を用いることにより焼成は 1100℃以下、950~1080℃程度と比較的低温で行 うことができる。

料粉末にパインダー、溶剤等を加えスラリー化し て、グリーンシートを形成し、このグリーンシー ト上に内部電極を印刷した後、所定の枚数を積 層、圧着し焼成することにより製造する。このと き、本発明の誘電体材料は低温で焼成できるた 40 に適している。 め、内部電極材料として例えば銀主体の安価で抵 抗率の低い材料を用いることができる。

また、このように低温で焼成が可能であること から、回路基板上等に印刷・焼成する厚膜誘電体 ペーストの材料としても有効である。

このような本発明磁器組成物は、従来まで鉛べ ロプスカイト複合化合物の欠点であつた積層セラ ミツクコンデンサとしたときの耐湿負荷テストに なつてしまい、また絶縁抵抗も低下し高い信頼性 5 優れ、高い絶縁抵抗、低い誘電損失、DCバイア ス特性が良好である。またCR値も大きく、特に 高温でも充分な値を有し、高温での信頼性に優れ ている。

6

T.C.Cの小さいことは本発明の大きな特徴であ ける誘電率が大幅に低下してしまう。また、添加 10 り、これは、K≥10000のごとくの大きな誘電率 の場合、特に顕著である。このように誘電率の大 きい場合には、(誘電率) / (温度変化率の絶対 値)の大きいことが要求される。本発明ではこの 点に関しても非常に優れている。

> さらに、誘電率パイアス電界依存性も従来のチ タン酸鉛系の材料と比較して優れており、誘電率 の変化率が4kV/mでも10%以下程度の材料を得 ることもできる。したがつて、高圧用の材料とし て有効である。また誘電損失が小さく、交流用、

さらに、前述のごとくT.C.C.が小さいため、電 歪素子へ応用した場合でも変位量の温度変化の小 さい素子を得ることができる。

さらに、焼成時のグレインサイズも 1~3μm

以上電気的特性について述べたが、機械的強度 も充分に優れたものである。

## 〔発明の効果〕

以上説明したように本発明によれば、重量比で る。このような原料粉末を用い所望の形状に成型 30 0.01~1.0重量%の酸化銀AgoO、酸化パラジウム PdO及び酸化白金PtOの少なくとも一種を含むこ とにより積層セラミツクコンデンサとしたときの 耐湿負荷テストに優れ、高い絶縁抵抗、低い誘電 損失、優れたT.C.C.及びDCパイアス特性が良好 積層タイプの素子を製造する場合は、前述の原 35 である高誘電率磁器組成物を得ることができる。 特に、このような各種特性に優れた磁器組成物は 低温焼成で得ることができるため、低コストの積 層セラミツクコンデンサ、積層型セラミツク変位 発生素子等の積層タイプセラミツク素子への応用

#### 〔発明の実施例〕

以下に本発明の実施例を説明する。

Pb, Ba, Sr, Zn, Nb, Ti, Mg, Ag, Pd, Ptの酸化物などの出発原料をボールミルなどで 混合し、700~850℃で仮焼する。ついでこの仮焼 体をボールミルなどで粉砕し乾燥の後、パインダ ーを加え造粒し、プレスして直径17歳、厚さ約2 mの円板状素体を形成した。混合、粉砕用のボー ルコニアボール等の硬度が大きく、かつ靱性の高 いポールを用いることが好ましい。

この素体を空気中980~1080℃、2時間の条件 で焼結し、両主面に銀電極を焼付け各特性を測定 した。誘電損失、容量は、1KHz、1Vrms、25℃ 10 た。その結果を第1表に示す。

の条件でのデジタルLCRメータによる測定値で り、この値から誘電率を算出した。また、絶縁抵 抗は、1000Vの電圧を2分間印加した後、絶縁抵 抗計を用いて測定した値から算出した。なお、 ルは、不純純の混入を防止するため部分安定化ジ 5 T.C.C.は、25℃の値を基準とし、-25℃、85℃、 での変化率で表した。容量抵抗積は、25℃および 125℃での (誘電率)×(絶縁抵抗)×(真空の誘電 率)から求めた。絶縁抵抗の測定は、空気中の湿 気の効果を除くためシリコーンオイル中で行つ

8

9

10

	誘電率温度係数	+85°C (%)	-11	-15	<del>1</del> 2-	66-	<b>8</b> 7-	<b>6</b>	-41	-39	-36	-43	-39	-40	-36	-55	40	-12	-19	-41	-48	-40
	誘電率	-25°C (%)	-10	11-	06—	-33	-40	-45	-44	-40	-38	98—	-28	-31	40	54	-42	-14	-10	35	-29	-45
	CR値 125℃	(af)	5200	6000	4800	0006	4800	5200	6300	8200	0066	4000	2800	9088	5500	5200	1000	4700	3300	0009	3900	110
	SS 25で で	(ar)	33000	29000	22000	47000	39000	30000	33000	39000	40000	38000	36000	42000	28000	27000	2600	27000	17000	34000	22000	4900
	D. F.	(%	0.3	0.5	0.9	0,3	0,3	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0.8	6.0	2,0	0,8	0.7	0,4	0.9	6.0
聚	誘電率	ید	4000	6300	8000	10200	12600	12000	11500	11000	0086	10800	1000	11800	10000	16600	14000	4900	6500	11000	12000	9600
		Pt0 (#t%)	0	0	0	0, 1	0	0	0	0.05	0,1	0.2	0	0.02	0	0.5	0.01	0	0	0	0	0
	添加物	Pd0 (#1%)	0	0,01	0	0	0,1	0	0.01	0	0, 1	0.2	0,2	0,02	1.0	0	0	0	0	0	0	1,5
1		Ag20 (#1%)	1.0	90.0	0.5	0	0, 1	0.01	0.05	0,1	0,5	0.2	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0,005	0
	Z D3	(%[om)	19	29,5	38	0	10	10	10	10	10	10	10	20	20	5	5	19	29.5	0	10	10
無	Nbg)×Ngg Nbg)y Ti ZDs	, y (mo1%)	1	0,5	2	20	40	40	40	40	40	50	20	50	90	85	90	1	0,5	50	40	40
	Nbz)×Kg	(%]om)	98	02	60	20	20	20	20	20	20	40	40	30	20	10	2	80	70	20	20	83
	(Pb, Mea) [(Zn <sub>1</sub>	Me=Sr (mo1%)	18	0	0	0	0	9	8	9	9	0	4	11	11	2	0	18	0	0	9	9
·	(Pb <sub>1</sub>	Me = Ba (mo 1%)	0	24	12	2	2	0	0	0	0	10	3	0	0	0	1	0	24	2	0	0
	N ish	N L L	実施例 1	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	12	参考例 1	2	8	<b>7</b>	5

12

積層セラミックコンデンサは以下の方法で作成 した。まず、このような組成を有する仮焼粉にバ インダー、有機溶剤を加えてスラリー化した後ド クタープレード型キヤスターを用いて45umのグ リーンシートを作成した。このグリーンシート上 5 に70Ag/30Pdの電極ペーストを所定のパターン で印刷し、このような電極パーンを有するシート を20層積層圧着した。その後、所定の形状に切断 し、脱脂を行い1040℃2hの条件で焼成を行つた。 焼結後、外部電極としてAgペーストを焼付け、10 積層セラミツクコンデンサを製造した。第2図は 上記の手段によつて得た積層セラミツクコンデン サを示すもので、第2表は、第1表に示す実施例 4の組成物を用い第2図に示すように構成した積 層セラミツクコンデンサの電気的特性を示すもの 15 第3表から明らかであるように、添加物の含まれ である。第2図中1は誘電体、2は内部電極、3 は外部電極である。

#### 2 表

形状	5.7×5.0×2.0(mm)					
一層当りの厚み	30(μm)					
容量	1.0(μF)					
誘電損失	0.5(%)					
絶縁抵抗	6.0×10 <sup>4</sup> (MΩ)					
容量抵抗積						
(25°C)	60000(MΩ • μF)					
(125°C)	10000(MΩ • μF)					
誘電率温度特性						
(~25℃)	-42(%)					
(85°C)	<b>-46(%)</b>					

第3表に実施例1、2、4および参考例1、3 の組成を用いて作成した積層セラミツクコンデン サにおける絶縁抵抗 (ΩF) の耐湿負荷テストの 結果を示す。

第 3 表

実施例	サンプル数	耐湿負荷テス トの不良数
実施例 1	100	0
実施例 2	100	0
実施例 4	100	0
参考例 1	100	5
参考例3	100	6

試験条件は40℃、95%RH、50V印加、2000時 間で行つた。数量は各ロツト100個である。判定 は試験後に500Ω以下となつたものを不良とした。 ない材料を用いた積層セラミツクコンデンサでは 試験後の絶縁抵抗が低下するものが5~6/100 個見られるのに対して、本発明による酸化物の Ag, Pd, Ptの少なくとも一種を0.01~1wt%含 20 む材料を用いて作成した積層セラミツクコンデン サは耐湿負荷テストにおける絶縁抵抗の低下が全 く見られない。

このように、本発明による高誘電率磁器組成物 は、各種特性に優れており、特に積層セラミツク 25 コンデンサ用の材料として有効である。

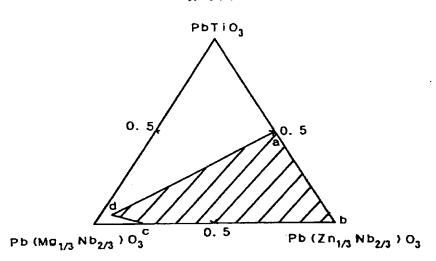
なお、上記説明では添加物であるAg, Pd, Pt を酸化物の形態で添加したが、金属粉末および塩 化物、硝酸化物として加えても同等の特性が得ら れ、これ等の方法も本発明の範囲に含まれること 30 は明らかである。

## 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の組成範囲を示す組成図、第 2図は、積層セラミツクコンデンサの一部切欠断 面斜視図である。

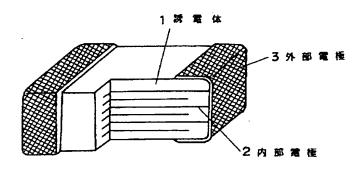
1 ------ 誘電体、2 ------ 内部電極、3 ------ 外部電 *35* 極。





本発明の組成範囲を示す組成階

# 第2図



積層セラミックコンデンサの一部切欠断面斜視図